

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

*К. т. н. В. Г. ВЕРБИЦКИЙ, к. т. н. В. И. ЗОЛОТАРЕВСКИЙ,
к. т. н. Ю. Е. НИКОЛАЕНКО, Л. И. САМОТОВКА,
Е. С. ТОВМАЧ*

Украина, г. Киев, НИИ микроприборов
E-mail:

Дата поступления в редакцию
30. 01 2001 г.
Оппонент к. т. н. М. Д. КАРДАЩУК

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КМОП ИС КЛЮЧЕЙ И КОММУТАТОРОВ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМНОГО КРЕМНИЯ

Показаны возможность и особенности применения объемного кремния при проектировании и освоении в производстве КМОП ИС ключей, коммутаторов.

В условиях, когда зарубежные производители и поставщики предлагают широкий спектр КМОП интегральных схем, различных по функциональному назначению, с широким диапазоном допустимых электрических и температурных воздействий, интегральные схемы, проектируемые и изготавляемые в Киевском НИИ микроприборов, могут привлечь внимание и заинтересованность потребителей только при гарантиях высокого качества, своевременных поставок и существенно более низкой цены КМОП ИС в сравнении с зарубежными функциональными аналогами. В связи с этим был выполнен технико-экономический анализ факторов, ограничивающих применение ряда материалов в проектировании и производстве КМОП ИС ключей с управлением, коммутаторов и переключателей. Были рассмотрены такие материалы на основе монокристаллического крем-

ния, как ДИКЭД-структуры, эпитаксиальные структуры, структуры на основе кремния на изоляторе и кремния с однородным распределением электрофизических параметров по всему объему пластины (объемный кремний).

В данной работе представлены некоторые конструкторско-технологические параметры, ограничивающие возможности проектирования на объемном кремнии КМОП ИС для средств связи, сбора, обработки информации и автоматизированного управления исполнительными устройствами.

Аналоговые ключи с управлением, коммутаторы, переключатели (**табл. 1**), освоенные в производстве, спроектированы в НИИ микроприборов на основе объемного кремния КДБ10(100) с *n*-карманной изоляцией *p*-канальных от *n*-канальных низкопороговых ($V_{th}=0,8\pm0,2$ В) МОП-транзисторов. Отдельный аналоговый ключ, у которого входом является соединенные сток *n*-канального с истоком *p*-канального МОП-транзистора, а выходом – соединенные исток *n*-канального со стоком *p*-канального МОП-транзистора, управляет разнополярными напряже-

Таблица 1

Электрические характеристики КМОП ИС

Обозначение	Сопротивление ключа, не более, Ом	Напряжение питания, В			Коммутируемое напряжение, В	Коммутируемый ток, мА	Аналог
		U_{cc1}	U_{cc2}	U_{cc3}			
Аналоговые ключи с управлением							
1834КН7 – 2-канальный	15,0	16,5; 52,0	–16,5; 0	—	15,0; 50,0	–15,0; 0	50,0
1834КН5 – 4-канальный	50,0	16,5	–16,5	5,5	15,0	–15,0	30,0
1834КН8В – 8-канальный	50,0	16,5; 52,0	–16,5; 0	—	15,0; 50,0	–15,0; 0	30,0
Коммутаторы							
1834КН3 – сдвоенный, 4-канальный	100,0	16,5	–16,5	—	15,0	–15,0	50,0
1834КН6 – 8-канальный	100,0	16,5	–16,5	—	15,0	–15,0	50,0
1834КН2 – сдвоенный, 8-канальный	100,0	16,5	–16,5	—	15,0	–15,0; 0	50,0
1834КН4 – 16-канальный	100,0	16,5; 52,0	–16,5; 0	—	15,0; 50,0	–15,0; 0	50,0
Переключатели							
1834КН10 – 4-канальный с попарным управлением	50,0	16,5	–16,5	—	15,0	15,0	20,0
1834КН11 – 4-канальный с общим управлением	50,0	16,5	–16,5	—	15,0	–15,0	20,0

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

ниями, которые подаются на затворы с выходных инверторов устройства управления ключом (УУК).

Для коммутации ключом напряжения положительной полярности на подложку p -канального МОП-транзистора необходимо подать положительное напряжение U_{cc1} не менее коммутируемого напряжения U_{k1} , а для коммутации ключом напряжения отрицательной полярности необходимо на подложку n -канального МОП-транзистора подать отрицательное напряжение U_{cc2} не менее (по модулю) коммутируемого отрицательного напряжения U_{k2} . Эти напряжения на подложках исключают возникновение не управляемых напряжений на затворах электрических токопроводящих цепей через $p-n$ -переходы "сток–подложка", "исток–подложка" в ключевых КМОП-транзисторах аналогового ключа. Подача отрицательного напряжения на подложку отдельного n -канального МОП-транзистора невозможна, т. к. при n -карманной изоляции p -канальных МОП-транзисторов n -канальные МОП-транзисторы могут быть созданы только на одной общей подложке объемного кремния p -типа проводимости. Поэтому отрицательное напряжение подается как на подложки n -канальных транзисторов аналоговых ключей, так и на подложки всех n -канальных транзисторов, входящих в состав УУК, в том числе во входном инверторе УУК. Управление входным инвертором устройства управления ключом осуществляется напряжением логического нуля ($0 \leq U_{bx} \leq 0,8$ В) и логической единицы ($3,0 \leq U_{bx} \leq 5$ В) от ТТЛ интегральной схемы.

Во входном инверторе устройства управления ключом отрицательное напряжение на общей подложке p -типа проводимости объемного кремния КМОП ИС увеличивает пороговое напряжение V_{tn} n -канального МОПТ [1, с. 114] на величину

$$\Delta V_{tn} = \frac{t_{0x} \sqrt{2N_a q \epsilon_0 \epsilon_n} (\sqrt{|2\Psi_F + U_{pin}|} - \sqrt{2|\Psi_F|})}{\epsilon_0 \epsilon_d}; \quad (1)$$

$$V_n = V_{tn} + \Delta V_{tn}, \quad (2)$$

где t_{0x} – толщина подзатворного диэлектрика;

V_n – пороговое напряжение n -МОПТ с учетом влияния напряжения $U_{pin} = U_{cc2}$;

U_{pin} – отрицательное напряжение на подложке относительно истока n -канального МОПТ, равное U_{cc2} и максимальному (по модулю) отрицательному коммутируемому напряжению U_k ;

V_{tn} – пороговое напряжение при $U_{pin}=0$.

Так, для коммутации ключом отрицательного напряжения $U_k = -16,5$ В подают такое же напряжение U_{cc2} на общую подложку КМОП ИС и, при концентрации акцепторов в подложке объемного кремния, равной 10^{15} см^{-3} , это напряжение увеличивает пороговое напряжение (2) n -канального МОП-транзистора во входном инверторе устройства управления ключом от $V_{tn} = 1,0$ В до $V_n = 3,0$ В. И тогда во входном инверторе для переключения n -МОПТ из закрытого в открытое состояние на его затвор необходимо подать напряжение логической единицы не менее 5 В. Для КМОП ИС, представленных в табл. 1,

управляющее напряжение 5 В подают на затвор n -МОПТ путем подключения резистора между выводом питания ТТЛ ИС и ее выходом. Такое подключение резистора рекомендуется и для КМОП ИС при отрицательных напряжениях питания U_{cc2} в диапазоне от минус 16,5 В до минус 5 В и напряжениях коммутации (по модулю) менее 16,5 В.

На рис. 1 представлены предельные значения коммутируемых напряжений ключом на нагрузку 1000 Ом в зависимости от величины отрицательного напряжения питания U_{cc2} КМОП ИС УР1834КН7, УР1834КН8 и УР1834КН4В. Заштрихованная область между линиями 1 и 2 представляет возможный диапазон коммутируемых напряжений при условии $U_{k1} \leq U_{cc1}$ и $|U_{k2}| \leq |U_{cc2}|$. Ключи с управлением, коммутаторы, переключатели коммутируют также напряжения в пределах $-|U_{cc2}| \leq U_k \leq U_{cc1}$ и в диапазоне низких напряжений питания вплоть до $U_{cc1} \geq 4$ В, $-16,5 \leq U_{cc2} \leq 0$ В.

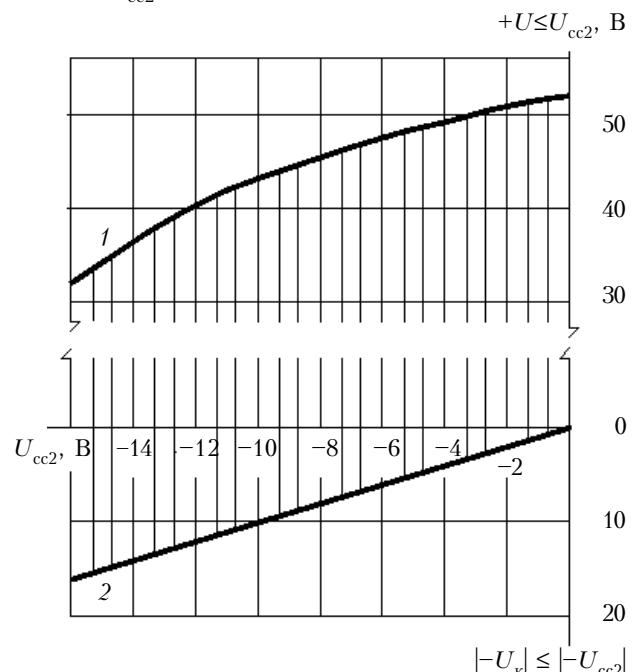


Рис. 1. Зависимость максимально возможного положительного коммутируемого напряжения ($U_k \leq U_{cc1}$) от величины отрицательного напряжения питания U_{cc2} КМОП ИС (отрицательное напряжение коммутации $U_k = U_{cc2}$):

1 – $U_{k1} = U_{cc1}$; 2 – $U_{k2} = -U_{cc2}$

Как видно из рис. 1, конструкция КМОП ИС на основе n -карманной изоляции p -канальных комплементарных МОП-транзисторов при условии $U_{cc1} \geq U_k$, $U_{cc2} = 0$ обеспечивает коммутацию положительного однополярного напряжения U_k до 50 В, а также [2] обладает более высокой устойчивостью к возникновению тиристорного эффекта и радиационному воздействию α -частиц в сравнении с p -карманной изоляцией n -канальных комплементарных транзисторов. Однако n -карманная изоляция комплементарных p -МОП-транзисторов не обеспечивает управление входного инвертора уровнем напряжения логической единицы от ТТЛ ИС при коммутации ключом двухполарного напряжения в диапазоне более чем

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

± 20 В из-за увеличения порогового напряжения V_{tn} в n -МОП-транзисторах до уровня выше предельно допустимого.

Вопросы проектирования высоковольтных КМОП ИС коммутаторов, ключей с управлением, переключателей, преобразователей уровней напряжений в диапазоне не более ± 50 В требуют нахождения компромиссных конструкторско-технологических решений по обеспечению:

- пробивных напряжений выше 100 В $p-n$ -переходов "сток – подложка", "исток – подложка" и предотвращения смыкания сток-истоковых $p-n$ -переходов при минимально допустимом расстоянии L между ними для получения низкого, менее 100 Ом, сопротивления открытого ключа на основе комплементарных МОП-транзисторов;

- оптимального соотношения размеров W_n , L_n и W_p , L_p – соответственно, ширины и длины каналов n - и p -канальных МОП-транзисторов во входном инверторе устройства управления ключом, зависящего от величины положительного напряжения питания КМОП ИС;

- высоких, более 100 В, пробивных напряжений подзатворного диэлектрика с одновременным получением низких пороговых напряжений n - и p -канальных МОП-транзисторов в пределах $(0,8 \pm 0,2)$ В для эффективного управления входным инвертором устройства управления ключом уровнями напряжений логической единицы и нуля от ТТЛ ИС.

Проектирование высоковольтных аналоговых ключей для коммутации предельных напряжений ± 50 В проводится, с учетом обеспечения пробивных напряжений $p-n$ -переходов p -канальных МОПТ выше 100 В, на основе выбора подложки объемного кремния n -типа проводимости с максимально допустимой концентрацией доноров 10^{15} см^{-3} , что соответствует кремнию марки КЭФ 4,5 (100). Такого же порядка предельно допустимую результирующую концентрацию акцепторных и донорных примесей, с учетом перекомпенсации примесной проводимости, технологически обеспечивают на поверхности p -кармана и n -областей стока, истока n -канальных МОП-транзисторов.

Пробивные напряжения $p-n$ -переходов также зависят от радиуса кривизны $p-n$ -перехода [3, с. 61–66], максимальной разницы потенциалов между затвором и стоком в закрытом состоянии КМОП-транзисторов ключа [4, с. 72] и расстояния от контакта области стока до подзатворного диэлектрика.

Разность потенциалов между затвором и стоком в закрытом состоянии ключа на основе КМОПТ приводит к инверсии проводимости области стока, находящейся под затвором. Инверсионный слой ограничивает расширение $p-n$ -перехода "сток-подложка" в сторону истока. Обедненный слой $p-n$ -перехода формируется на поверхности области стока между контактом стоковой области и границей диэлектрика, находящегося под поликремниевым затвором. Лавинный пробой $p-n$ -перехода "сток-подложка" возникает в случае превышения предельно допустимой напряженности электрического поля в $p-n$ -переходе на поверхности стоковой области.

На основании эмпирической зависимости между величиной напряжения лавинного пробоя резкого $p-n$ -перехода и концентрацией примеси N , а также предельно допустимой напряженностью электрического поля в $p-n$ -переходе $E(N)$ [3, с. 51–60], минимально допустимое расстояние l от контакта к области стока до подзатворного диэлектрика, находящегося под поликремниевым или алюминиевым затвором, определяют из соотношений

$$l \geq \frac{258 \cdot (10^{15})^{0.75}}{N^{0.75} E(N)} \text{ для } 4 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3} < N < 4 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}; \quad (3)$$

$$l \geq \frac{53.6 \cdot (10^{16})^{0.56}}{N^{0.56} E(N)} \text{ для } 4 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3} < N < 3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}. \quad (4)$$

Увеличение расстояния l более 3 микрон нецелесообразно из-за существенного вклада линейного сопротивления области стока R_c в общее сопротивление открытого ключа.

Размеры W_n , L_n и W_p , L_p комплементарных транзисторов входного инвертора УУК рассчитываются на основании заданных уровней входных напряжений логической единицы и нуля, подаваемых с выхода ТТЛ ИС, напряжения питания U_{cc1} , а также необходимых на выходе входного инвертора напряжений логической единицы $U_{cc1} - V_{tp} \leq U_{\text{вых}(1)} \leq U_{cc1}$ и логического нуля $0 \leq U_{\text{вых}(0)} \leq V_{tn}$. На **рис. 2** представлены зависимости минимально допустимых значений отношения удельной крутизны β_n к β_p для n - и p -канальных МОП-транзисторов входного инвертора от величины напряжения питания U_{cc1} при различных постоянных значениях входного напряжения логической единицы $U_{\text{вх}(1)}$, выходного напряжения логического нуля $U_{\text{вых}(0)} \leq 0,6$ В и пороговых напряжений $V_{tn} = V_{tp}$.

Используя модель МОПТ в области насыщения выходных ВАХ при заданных токе потребления, U_{cc1} , V_{tp} , t_{0x} , μ_{p0} и необходимом значении времени переключения из состояния логического нуля в состояние логической единицы входного инвертора, определяют отношение $a = W_p / L_p$ для p -канального МОПТ. (Здесь μ – подвижность носителей зарядов в канале.) На основании конструктивно-технологических ограничений при $a < 1$ выбирают минимальный размер W_p , определяют L_p .

Исходя из заданных величин $V_{tp} = V_{tn}$, $U_{\text{вх}(1)}$, по графической зависимости на **рис. 2** определяют минимально допустимое значение β_n / β_p и из соотношения

$$\frac{\beta_n}{\beta_p} = \frac{W_n L_p \mu_{n0} [1 + \Theta(U_{cc1} - U_{\text{вх}1} - V_{tp})]}{W_p L_n \mu_{p0} [1 + \Theta(U_{\text{вх}1} - V_{tn})]} \quad (5)$$

определяют W_n / L_n , выбирают L_n и определяют W_n для n -канального МОПТ входного инвертора. (Здесь Θ – коэффициент, учитывающий снижение подвижности заряда в канале при увеличении напряжения на затворе.)

Информативные параметры модели МОП-транзистора (такие как β , μ , θ , пороговые напряжения и сопротивления области стока R_c истока R_i и канала

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

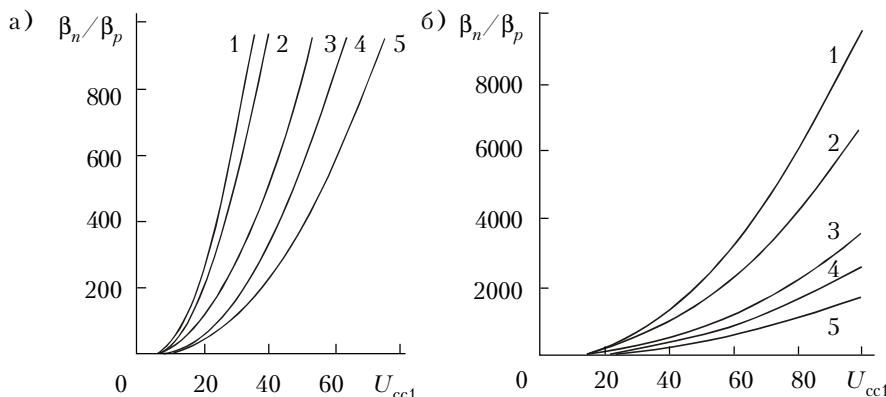


Рис. 2. Зависимость минимально допустимого отношения β_n/β_p в МОП-транзисторах входного инвертора от напряжения питания U_{cc1} для низковольтных (а) и высоковольтных (б) КМОП ИС ($U_{\text{вых}(0)} \leq 0,6 \text{ В}; V_{tp} = V_{tt}$):
 1 – $V_t = 2,2 \text{ В}, U_{bx(1)} = 3,0 \text{ В};$
 2 – $V_t = 0,8 \text{ В}, U_{bx(1)} = 2,0 \text{ В};$
 3 – $V_t = 0,8 \text{ В}, U_{bx(1)} = 3,0 \text{ В};$
 4 – $V_t = 2,2 \text{ В}, U_{bx(1)} = 5,0 \text{ В};$
 5 – $V_t = 0,8 \text{ В}, U_{bx(1)} = 5,0 \text{ В}$

ла R_k , а также параметры модели $p-n$ -переходов определялись на тестовых элементах с помощью аналитических зависимостей и методов, представленных в работах [5, 6].

Пробивное напряжение подзатворного диэлектрика $U_{\text{зп}}$ определяется его толщиной t_{0x} , которая зависит от технологических режимов его создания. Для напряжения между затвором и подложкой $U_{\text{зп}} = 100 \text{ В}$ требуемая толщина составляет $t_{0x} = 1200 \dots 1500 \text{ \AA}$.

Низкий уровень порогового напряжения V_{tp} ($0,8 \pm 0,2 \text{ В}$) в n -канальных МОП-транзисторах достигается путем их изоляции от общей подложки объемного кремния n -типа проводимости и p -канальных МОП обратносмещенные $p-n$ -переходами (p -карманы), выбором кристаллографической ориентации плоскости (100) объемного кремния на границе раздела "диэлектрик–полупроводник", а также дозами ионного легирования бором областей каналов комплементарных МОП-транзисторов $0,01 \dots 0,03 \text{ мккулон}$. В p -карманах истоки n -МОПТ электрически соединяются с их подложками ($U_{\text{пп}} = 0$).

На общей подложке объемного кремния n -типа проводимости создают p -канальные МОП-транзисторы. Их пороговое напряжение $U_{tp} = 0,8 \pm 0,2 \text{ В}$ обеспечивают ионным легированием бором областей каналов в n -подложке объемного кремния и соединением области истока с общей подложкой n -типа проводимости, при этом $U_{\text{пп}} = 0$.

Низкий уровень (менее 100 Ом) сопротивления открытого ключа R_k , предотвращение смыкания областей стока с истоком при коммутации напряжений $\pm 50 \text{ В}$, минимальное влияние положительного и отрицательного напряжений на подложке соответственно p - и n -канальных МОП-транзисторов ключа обеспечивается, исходя из выражений для R_k и V_t [7], максимально допустимой концентрацией доноров в подложке объемного кремния 10^{15} см^{-3} , поверхностной концентрацией акцепторов в p -кармане не более $4 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$, созданием плавных $p-n$ -переходов с градиентом концентрации не более $4 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-4}$, выбором кристаллографической плоскости (100) на границе раздела "подзатворный диэлектрик – полупроводник", поликремниевыми затворами, легированными фосфором, минимально возможной толщиной подзатворного диэлектрика 1200 \AA на основе двуокиси кремния с $\epsilon_d = 3,9$, минимально допустимым расстоянием от подзатворного диэлектрика до кон-

тактов к стоковой, истоковой области, определяемого из выражений (3), (4), а также соотношения W/L в комплементарных МОП-транзисторах ключа с минимально допустимыми значениями $L = 6 \text{ мкм}$.

Кроме того, в проектируемых КМОП ИС путем выбора конструкции ключа на основе двух последовательно соединенных с общими истоками n -канальных МОП-транзисторов и создания новой схемы управления таким ключом обеспечивается коммутация двухполлярных ($\pm 50 \text{ В}$) напряжений при использовании только одного положительного источника напряжения питания КМОП ИС (см. табл. 2).

Создание КМОП ИС ключей с управлением, коммутаторов с коммутируемым напряжением более $\pm 50 \text{ В}$ на объемном кремнии возможно при концентрации доноров в подложке менее 10^{15} см^{-3} , но это приведет к значительному росту сопротивления ключа из-за необходимого увеличения длины канала МОПТ для исключения смыкания $p-n$ -переходов "сток–исток". А увеличение ширины канала W для снижения сопротивления ключа в открытом состоянии приводит к увеличению площади, занимаемой КМОП ИС, и экономической неэффективности их производства. Поэтому проектирование КМОП ИС для коммутации напряжений в диапазоне более $\pm 50 \text{ В}$ при обеспечении сопротивления ключа порядка единиц или десятков Ом необходимо проводить на основе применения ДИКЭД-структур с формированием ДКМОП-транзисторов.

Таким образом, проектирование высоковольтных КМОП БИС ключей и коммутаторов на основе изоляции p -канальных МОП-транзисторов от подложки кремния p -типа проводимости $p-n$ -переходами, с обеспечением управления входным инвертором устройства управления ключом управляющим напряжением от ТТЛ ИС ограничивается максимально допустимым отрицательным напряжением питания и коммутации $U_{cc2} \leq -20 \text{ В}$, т. к. это напряжение, подаваемое на общую подложку всех n -МОП-транзисторов с индуцированными каналами, увеличивает пороговое напряжение и n -канального МОП-транзистора во входном инверторе – до уровня, при котором положительное управляющее напряжение от ТТЛ ИС уже не в состоянии открыть его и переключать входной инвертор из состояния логической единицы в состояние логического нуля.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Таблица 2

Электрические характеристики проектируемых КМОП ИС

Обозначение	Сопротивление ключа, не более, Ом	Напряжение питания, В		Коммутируемое напряжение, В	Коммутируемый ток, мА	Аналог	
		U_{cc1}	U_{cc2}				
5701KH04 — 4-канальный ключ	50	4,5...55,0	—	50	-50	50	АДG441
5701KH16 — 16-канальный коммутатор	100	4,5...55,0	-27,5...0	25	-25	30	АДG506A

Проектирование высоковольтных КМОП ИС ключей и коммутаторов на основе подложек объемного кремния n -типа проводимости и изоляции p -карманных МОП-транзисторов от подложки $p-n$ -переходами позволяет увеличить коммутируемые отрицательные напряжения до $| -50 |$ В, благодаря возможности исключения влияния отрицательного напряжения $U_{cc2} \leq | -50 |$ В на пороговое напряжение n -канального МОП-транзистора во входном инверторе путем электрического соединения его истока с подложкой в p -кармане. Ограничивающими факторами проектирования ключей, коммутаторов, переключателей для коммутации положительных и отрицательных напряжений в диапазоне более ± 50 В являются пробивные напряжения $p-n$ -переходов и экономическая нецелесообразность увеличения пробивных напряжений путем снижения концентрации примесей в подложке объемного кремния n -типа проводимости, т. к. это, в итоге, для обеспечения сопротивления открытого ключа менее 100 Ом приводит к существенному увеличению площади, занимаемой КМОП ИС на пластине кремния.

В КНИИ МП проектирование ключей с управлением, коммутаторов, переключателей для коммутации напряжений более ± 50 В осуществляется

на основе ДКМОП-транзисторов с применением ДИКЭД-структур.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Интегральные схемы на МДП-приборах. — М.: Мир, 1975.
2. Shimohigashi K. and other. An n -well CVOS dinamic RAM // IEE Trans. — 1982. — Vol. SC-17, N 2. — P. 344–348.
3. Грехов И. В., Сережкин Ю. Н. Лавинный пробой $p-n$ перехода в полупроводниках. — Л.: Энергия, 1980.
4. Ричман П. Физические основы полевых транзисторов с изолированным затвором. — М.: Сов. радио, 1971.
5. Zolotarevsky V. I., Serdyuk G. B., Samotovka L. I. et al. SOI-based Ics design, technology and electrical diagnostics // Physical and technical problem of SOI structures and devices. — Gurzuf, Ukraine. — November 1–4, 1994. — P. 69–70.
6. Lysenko V. S., Zolotarevsky V. I., Samotovka L. I. et al. $P-n$ junction informative parameters and yield of SOI CMOSICs // Perspectives, science and technologies for novel silicon on insulator Devices. — Kyiv, Ukraine. — October 12–15, 1998. — P. 25.
7. // Зарубежная электронная техника. — М.: ЦНИИ “Электроника”, 1976. — Вып. 21. — С. 10–11.